大面積マイクロ波プラズマの円筒キャビティ励起の最適化 II

Optimization of Cylindrical Cavity Excitation for Large-Area Microwave Plasma Generation II

中部大工¹, アプライドマテリアルズ², 名産研³, ○長谷川雄一¹,小川大輔¹, 中村圭二¹, 小林 理², 菅井秀郎³

Chubu Univ.¹, Applied Materials², NISRI³ ^oYuichi Hasegawa, Daisuke Ogawa¹, Keiji Nakamura¹, Satoru Kobayashi², Hideo Sugai³ E-mail: hase589406@gmail.com

1. はじめに

マイクロ波プラズマは通常、方形導波管や同 軸導波管の壁面にスロットを切って励起する が、我々は**円筒キャビティ**を用いた励起を試み、 プラズマの均一性と制御性を高める研究を始 めている。前回の講演では、キャビティに二方 向から 2.45 GHz のマイクロ波を入射する Dual Injection により、キャビティ内の電磁界を回転 させる FDTD シミュレーションを行った結果 を報告した(Fig.1 参照)。

今回は実際に内径 38cm の円筒キャビティを 製作し、Single Injection と Dual Injection を比 較しながら放電実験を行ったので報告する。

2. 励起方法

Fig. 2に示すように方位角方向に90[°]離れた 2ヶ所から方形導波管を介して 2.45 GHz のマ イクロ波を円筒キャビティに入射する。Fig. 3 は Single Injection 時の S₁₁ スペクトルであり、 2.45 GHz で TE₁₁₁ モードの共振が起きているこ とを示している。このキャビティの低面に設け てあるスロットからマイクロ波を放射して放 電容器内にプラズマを生成する。

3. プラズマ生成

スロットアンテナの下には多数の孔をもつ ホロー板を設けてプラズマの均一化をはかる。 Fig. 4はAr 100Paで2つのポートから200Wず つ入射し、両者の位相差を適当に調整したとき に得られたプラズマの発光写真の例である。



2440 2450 2460 Fig. 3. Cavity resonance at 2.45GHz.



Fig. 4. Optical emission image of plasma.



Fig. 1. Magnetic field profile on the plane z=0 for successive wave phase (ωt).